

【11】證書號數：I304669

【45】公告日：中華民國97(2008)年12月21日

【51】Int. Cl. : H01T19/00 (2006.01)

發明 全 4 頁

【54】名稱：電暈處理效果之自動調整系統

【21】申請案號：094124772

【22】申請日：中華民國94(2005)年7月21日

【11】公開編號：200705763

【43】公開日：中華民國96(2007)年2月1日

【72】發明人：許耿禎 SHEU, GEENG JEN

【71】申請人：修平技術學院 HSIUPING INSTITUTE OF TECHNOLOGY
臺中縣大里市工業路11號

【74】代理人：劉緒倫

【56】參考文獻：

TW 22270

TW 576573

TW 88018

TW 200421684A

JP 6-163143A

JP 10-241827A

JP 2000-82565A

US 6320157B1

1

2

[57]申請專利範圍：

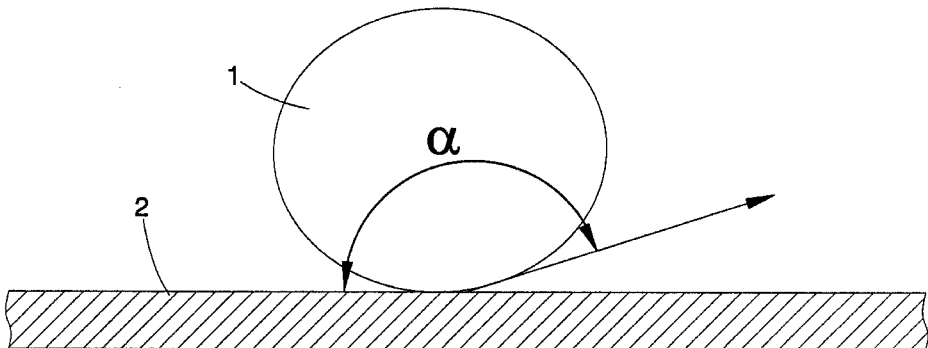
- 1.一種電暈處理效果之自動調整系統，包含有：
 - 一傳送機構裝置，用於提供一橫向移動之功能；
 - 一電暈放電器，設於該傳送機構裝置之一側，用於提供一適當之放電效果；
 - 一CCD偵測器，設於該傳送機構裝置之一側；
 - 一調整控制處理器，分別與該偵測

器、電暈放電器、傳送機構裝置連接，可依偵測器所測得的數值線上自動調整控制傳送機構裝置或電暈放電器，以達到預期可接受的電暈處理效果。

- 5. 2.依據申請專利範圍第1項所述電暈處理效果之自動調整系統，其中該調整控制處理器可依偵測器所測得的數值，調整控制傳送機構裝置的移動速度。
- 10.

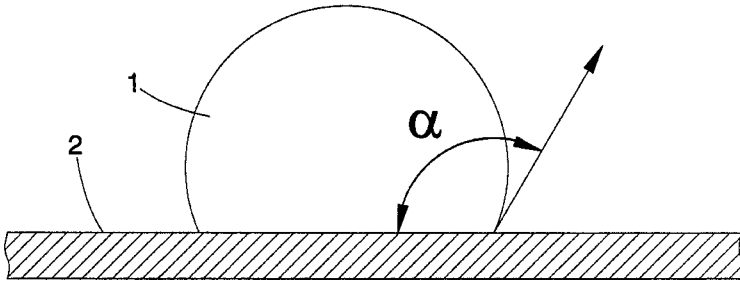
3. 依據申請專利範圍第1項所述電暈處理效果之自動調整系統，其中該調整控制處理器可依偵測器所測得的數值，調整控電暈放電器之電壓大小。
4. 依據申請專利範圍第1項所述電暈處理效果之自動調整系統，其中該調整控制處理器可依偵測器所測得的數值，調整控電暈放電器之電流大小。
5. 依據申請專利範圍第1項所述電暈處理效果之自動調整系統，其中該調整控制處理器可依偵測器所測得的數值，調整控電暈放電器之位置。
6. 依據申請專利範圍第1項所述電暈處理效果之自動調整系統，其中該偵測器可以依需求而調整及改變其觀測之位置或角度。
7. 依據申請專利範圍第1項所述電暈處理效果之自動調整系統，其中該傳送機構裝置可以為一輸送帶。

8. 依據申請專利範圍第1項所述電暈處理效果之自動調整系統，其中該傳送機構裝置可以為一傳送軸組。
9. 依據申請專利範圍第1項所述電暈處理效果之自動調整系統，其中該傳送機構裝置可以為一滾輪組。
10. 依據申請專利範圍第1項所述電暈處理效果之自動調整系統，其中該傳送機構裝置至少設有一馬達動力源。
11. 依據申請專利範圍第5項所述電暈處理效果之自動調整系統，其中該電暈放電器至少設有一可移動位置機構。
15. 圖式簡單說明：
第一圖至第三圖分別表示待加工物品與油墨之間不同表面附著能量分佈型態之示意圖。
第四圖為本發明之結構示意圖。
第五圖為本發明調整控制方式流程之示意圖。
- 20.

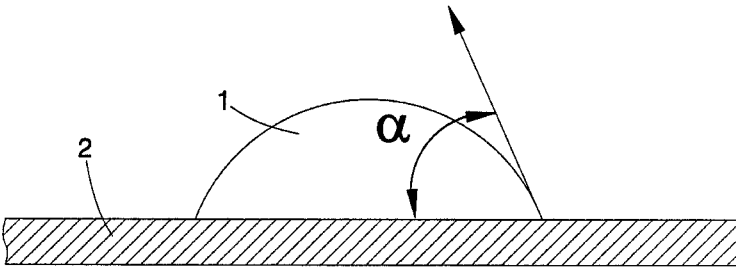


第一圖

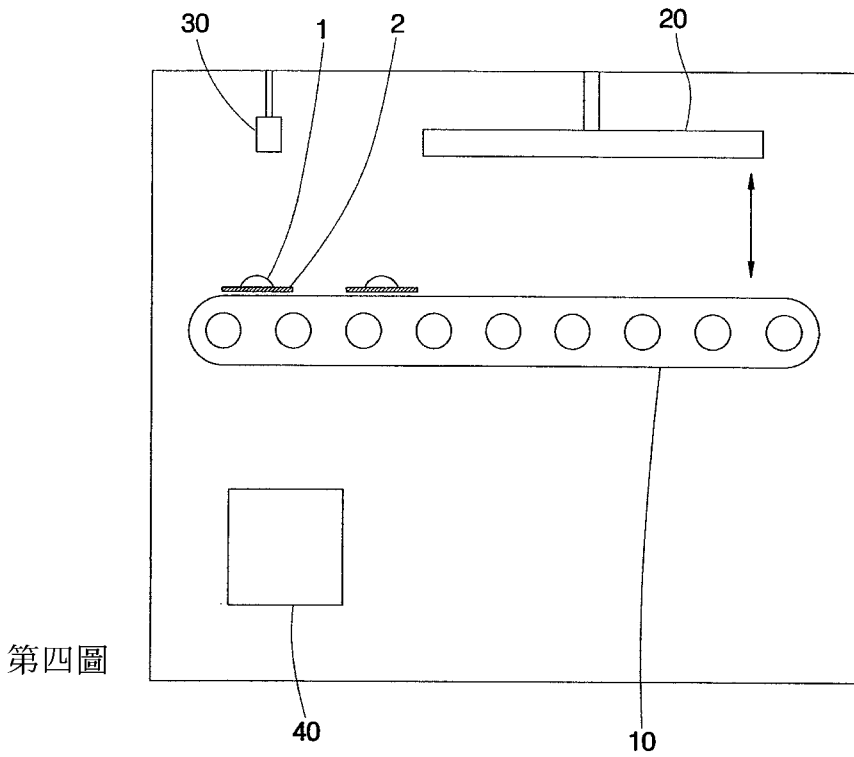
(3)



第二圖

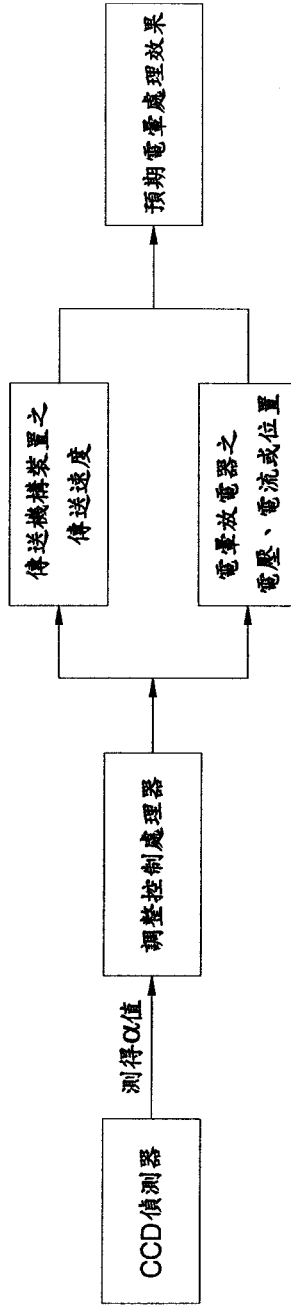


第三圖



第四圖

(4)



第五圖